【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和7年3月6日(2025.3.6)

【国際公開番号】WO2024/201576
【出願番号】特願2024-560951(P2024-560951)
【国際特許分類】
C25B 11/077(2021.01)
C25B 9/63(2021.01)
C25B 9/23(2021.01)
C25B 11/052(2021.01)
C25B 11/03(2021.01)
C25B 9/00(2021.01)
C25B 1/042(2021.01)
H01M 4/86(2006.01)
H01M 8/12(2016.01)
H01M 8/1226(2016.01)
H01M 4/90(2006.01)
【FI】
C25B 11/077
C25B 9/63
C25B 9/23
C25B 11/052
C25B 11/03
C25B 9/00 A
C25B 1/042
H01M 4/86 B
H01M 4/86 U
H01M 8/12 101
H01M 8/12 102A
H01M 8/1226
H01M 4/90 M

【手続補正書】
【提出日】令和6年10月16日(2024.10.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
主面に形成された複数の連通孔を有する金属支持体と、
前記主面上に形成され、前記複数の連通孔を覆う第１電極層と、第２電極層と、前記第１電極層及び前記第２電極層の間に配置される電解質層とを有するセル本体部と、
を備え、
前記第１電極層は、
前記金属支持体と接触する第１面から厚み方向に５μｍ以内の第１領域と、
前記電解質層と接触する第２面から厚み方向に５μｍ以内の第２領域と、
前記第１領域及び前記第２領域の間の第３領域と、

を有し、
前記第１領域、前記第２領域、及び前記第３領域それぞれは、ニッケルと酸化物イオン伝導性材料とを含有し、
前記第１領域におけるニッケルの含有率は、前記第３領域におけるニッケルの含有率より低く、
前記第２領域におけるニッケルの含有率は、前記第１領域におけるニッケルの含有率より低い、
電気化学セル。
【請求項２】
前記第２領域におけるニッケルの含有率は、前記第３領域におけるニッケルの含有率より低い、
請求項１に記載の電気化学セル。
【請求項３】
前記第１電極層は、前記複数の連通孔のうち少なくとも１つの内側に配置される第４領域を有し、
前記第４領域は、ニッケルと酸化物イオン伝導性材料とを含有し、
前記第４領域におけるニッケルの含有率は、前記第３領域におけるニッケルの含有率より低い、
請求項１又は２に記載の電気化学セル。